PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

58-076411

(43) Date of publication of application: 09.05.1983

(51)Int.Cl.

CO8F212/36

(21)Application number: 56-174989

(71)Applicant:

HIGASHIMURA TOSHINOBU

(22)Date of filing:

31.10.1981

(72)Inventor:

HIGASHIMURA TOSHINOBU

HASEGAWA HIROSHI

AOSHIMA SADATO

(54) POLYDIVINYLBENZENE COPOLYMER AND ITS MANUFACTURE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain titled linear polymer or oligomer carrying terminal styrene, suitable as an intermediate, by carrying-out copolymerization between divinylbenzene and a styrene monomer in the presence of a sulfonate anion or a perchloric acid anion.

CONSTITUTION: The objective copolymer can be obtained by the copolymerization, at 20W150° C, between (A) divinylbenzene and (B) a styrene monomer of formulaI[X is (halogenated) alkyl, acyl(oxy), OH, halogen, etc.]in the presence of a sulfonate anion or a perchloric acid anion. The resultant copolymer consists of at least one or two sorts of components of formula II-VI (r is an integer: ≥0; M is expressed by formula VII or VIII).

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭58-76411

⑤ Int. Cl.³
 ⑥ 08 F 212/36

識別記号

庁内整理番号 7016—4 J 砂公開 昭和58年(1983)5月9日

発明の数 3 審査請求 未請求

(全 13 頁)

⊗ポリジビニルベンゼン共重合体およびその製法

印特

顧 昭56-174989

22)H

顧 昭56(1981)10月31日

特許法第30条第1項適用 昭和56年5月1日 発行社団法人高分子学会の高分子学会予稿集 に発表

72発 明 者 東村敏延

京都市左京区北白川伊織町35

@発 明 者 長谷川洋

大阪市都島区中野町3-1-22

⑩発 明 者 青島貞人

水戸市緑町3-3-9

の出願人 東村敏延

京都市左京区北白川伊織町35

四代 理 人 弁理士 前島肇

明細 響

1. 発明の名称

ポリシピニルペンセン共重合体およびその製法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 下記一般式(T) から(V) で表わされる群から選ばれた 1 種または 2 種以上の化合物からなるポリッピニルベンセン共重合体。
 - 般 式(I)

- 般 式(])

一般式(E)

¥ - 股 式(Ⅳ)·

$$\chi = \begin{array}{c} -\text{CH-CH-CH-CH} & \longrightarrow_{\mathcal{I}} \text{CH-CH-CH} \\ \text{CH}_3 & \text{CH-CH-CH} \\ \end{array}$$

一 般 式(V)

但し、上記一般式(I)から(V)において、X は低級アルキル基、ハロゲン化アルキル基、アンル基、アンル基、アンルオキシル基、ヒドロキシル基もしくはハロゲン原子を安わし、エは O 以上の整数であり、かつエ個の N は、それぞれ下配繰返し単位(A)または(B)である。

繰返し単位(A)

24返し単位(B)

- (2) 前記ポリソビニルベンゼン共取合体中の二重結 合が主としてトランス結合である特許請求の範囲 第1項記載のポリジビニルベンゼン共取合体。
- (3) 前記ポリジピニルペンセン共重合体中のジピニルペンセン単位が p 置換ジピニルペンセン単位 および/または m 置換 ジピニルペンセン単位である特許請求の範囲第1項または第2項記載のポリジピニルペンセン共宜合体。
- (4) 前記 X がメチル基である特許請求の範囲第1項 ないし第3項のいずれかに記載のポリジピニルベ ンセン共重合体。
- (5) 前記 X がクロロメテル基である特許請求の範囲 第1項ないし第3項のいずれかに記載のポリジピ ニルベンセン共重合体。
- (6) 前記 X が T セトキシル基である 符許請求の範囲 第 1 項をいし第 3 項のいずれかに記載のポリジピ ・ ニルベンゼン共重合体。
- (7) 前記 X が塩素原子である特許 韻求の範囲第1項 たいし第3項のいずれかに記載のポリジビニルベンセン共重合体。

一 般 式(图)

- 股 式(N)

一 般 式(V)

- 股 式(VI)

但し、上記一般式(I)から(VI)において、 X は低級アルキル基、ハロゲン化アルキル基、アシル基、アシル基、アシル基、アシル基をしくはハロゲン原子を表わし、 r は O 以上の整数であり、かつ r 個の N は、それぞれ下記繰返し単位(A)また

- (8) 前記 X がアセチル差である特許請求の範囲第1項ないし第3項のいずれかに記載のポリジピニルベンセン共重合体。
- (8) スルホネートアニオンまたは過塩素酸アニオンの存在下に、-20°C~+150°Cにおいて、ジビニルベンセンを重合するに際し、下配一般式(VI)で示されるスチレン類を共存させることを特徴とする、下記一般式(I)から(V)で表わされる群から選ばれた1種または2種以上の化合物からなるポリンビニルベンゼン共重合体の製法、

— 般 式(I)

一般式(I)

は(B)である。

経返 L単位(A)

繰返し単位(B)

- (10) 前記ポリグビニルベンゼン共重合体の二重結合が主としてトランス結合である特許請求の範囲第9項記載のポリジビニルベンゼン共重合体の製法。
- (11)前記シピニルペンゼンが p-ツピニルペンゼン および/または m-ツピニルペンゼンである特許 請求の範囲第9項または第10項記載のポリシピニ ルペンゼン共電合体の製法。
- (12) 前配一般式(VI)で示されるステレン類がメチルステレンである特許請求の範囲第9項ないし第11項のいずれかに配数のポリジピニルベンゼン共宜合体の製法。
- (13) 前記一般式(VI)で示されるスチレン類がクロロメチルスチレンである特許請求の範囲第9項ない

し第11 項のいずれかに記載のポリジビニルベンセン共重合体の製法。

- (14)前記一般式(VI)で示されるスチレン類がアセトキシスチレンである特許請求の範囲第9項ないし 第11項のいずれかに記載のポリジピニルベンゼン 共重合体の製法。
- (18) 前記一般式(VI)で示されるスチレン類がクロロスチレンである特許請求の範囲第 B 項ないし第11項のいずれかに記載のポリジピニルベンゼン共貢合体の製法。
- (18) 前配一般式(VI)で示されるスチレン類がアセチルスチレンである特許請求の範囲第 9 項ないし第 11 項のいずれかに記載のポリジピニルベンセン共 重合体の製法。
- (17) スルホネートアニオンまたは過塩素酸アニオン の存在下に、-20°C~+150°Cにおいて、ジビニ ルベンセンを重合するに際し、下配一般式(VI)で 示されるアシルオヤンスチレンを共存させて得ら れたポリジビニルベンセン共重合体を加水分解す るととを特徴とする下記一般式(II)から(VI)で表

わされる群から選ばれた1種または2種以上の化合物からなるポリジピニルベンゼン共食合体の製法。

一般式(1')

HO CH-CH-CH-
$$\frac{1}{CH_3}$$
 CH- $\frac{1}{CH_2}$

- 股 式(1))

HO CH-CH-CH-CH
$$\rightarrow_{x}$$
 CH=CH₂

- 股式(11')

- 般 式(N')

一般式(√)

一 股 式(VI')

但し、上記一般式(I') から(Y') において、X' はア シルオキシル基を要わし、 r は 0 以上の整数であ り、かつ r 個の M は、それぞれ下記繰返し単位(A) または(B) である。

繰返 し単位(A)

繰返し単位(B)

(18) 前記ポリジビニルベンゼン共承合体中の二重結合が主としてトランス結合である特許請求の範囲 第17項記載のポリジビニルベンゼン共重合体の製 法。

- (19) 前記ジピニルベンセンが p-ジピニルベンセン および/または m-ジピニルベンセンである特許 請求の範囲第17項または第 18 項 記載のポリジピ ニルベンセン共宜合体の製法。
- (20) 前記アシルオキシスチレンがアセトキシスチレンである特許 請求の範囲第17項ないし第19項のいずれかに記載のポリジビニルベンセン共献合体の製法。
- 3. 発明の詳細な説明

本発明は、ジビニルベンゼンの末端にスチレン類を導入した鎖状ポリマーもしくはオリゴマーおよびその製造法に関するものである。

ツピニルベンセンは、その分子中に2個のピニル基を有しているので、一般に重合により溶鉄で発生の橋かけ構造を持ったポリマーを生成することが知られている。従って、ツピニルベンセとは他のモノマーとの共重合における橋かけ剤として用いられてかり、それ自体のホモポリマーをのはオリゴマーとして知られているものは、次の一

般式(VI)で示される化合物およびその橋かけ構造 化合物である。

~ 般 式(VII)

$$\begin{array}{cccc} \mathsf{CH}_3\text{-}\mathsf{CH} & & \leftarrow \mathsf{CH}_2\text{-}\mathsf{CH} \xrightarrow{}_{\mathtt{m}} & \mathsf{CH}\text{-}\mathsf{CH} \\ \mathsf{C}_6\mathsf{H}_4 & \mathsf{C}_6\mathsf{H}_4 & \mathsf{C}_6\mathsf{H}_4 \\ \mathsf{CH}\text{-}\mathsf{CH}_2 & \mathsf{CH}\text{-}\mathsf{CH}_2 & \mathsf{CH}\text{-}\mathsf{CH}_2 \end{array}$$

式中 mは1以上の整数である。

本発明者らは、先にスルホネートアニオンまたは過塩素酸アニオンの存在下にジピニルベンセンを重合させることにより、ジピニルベンセンの新規を組状ポリマーまたはオリゴマーが得られることを見出し特許出顧を行なった(特開昭58 - 62808号)。

更に本発明者らは、シピニルベンゼンを乗合させるに際し、ステレン類を共存させることにより、 末端に該スチレン類が導入された鎖状のポリシピ ニルベンゼン共重合体が得られることを見出し本 発明を完成させた。

すなわち、本発明は、下記の一般式(1)から(V) で扱わされる群から選ばれた1種または2種以上 の化合物からなるポリジピニルペンセン共賃合体 に関するものである。

一 般 式(])

$$X \xrightarrow{CH=CH-CH} \xrightarrow{CH_3} CH=CH_3$$

一 股 式(])

$$\begin{array}{c} \text{CH-CH=CH} & \xrightarrow{\text{H}} \text{CH-CH}_2 \\ \text{CH}_3 & \end{array}$$

- 般 式(II)

— 般 式(N)

$$X \longrightarrow CH-CH=CH \longrightarrow M \rightarrow_{x} CH=CH-CH \bigcirc X$$

- 股 式(V)

但し、上記一般式(I)から(V)において、X は低級アルキル基、ハロゲン化アルキル基、アシル基、アシル基、アシル基もしくはハロゲン原子を表わし、「は O 以上の整数であり、かつ「個の N は、それぞれ下記繰返し単位(A)または(B)である。

繰返し単位(A)

繰返し単位(B)

更に本発明は、スルホネートアニオンもしくは 逸塩素酸アニオンの存在下に、温度 – 20°C から + 150°C の範囲内でソビニルペンセンを重合する に際し、下記一般式(VI)で表わされるスチレン類 を共存させるととを特徴とする前配一般式(|)から(V)で表わされる群から選ばれた1種または2種以上の化合物からなるポリジピニルベンゼン共業合体の製法に関するものである。

- 般式(Vi)

なお式中人は前記定義と同じである。

更に本発明は、スルホネートアニオンまたは過塩素酸アニオンの存在下に、-20°C~+150°Cにおいて、ジビニルベンセンを重合するに際し、下配一般式(V')で示されるアシルオキシスチレンを共存させて得られたポリジビニルベンセン共重合体を加水分解することを特徴とする下記一般式(I')から(V')で安わされる静から選ばれた1種または2種以上の化合物からなるポリジビニルベンセン共重合体の製法に関するものである。

一 般 式([')

一 般 式(B')

HO CH-CH-CH-CH-
$$\frac{1}{c}$$
 CH=CH₂

一 般 式(Ⅱ')

— 股 式(N')

- 般 式(V')

但し、上記一般式(『)から(Vǐ)において、X'はア シルオキシル基を扱わし、エおよび M は前配定義 と同じである。

また、本発明の方法に使用するスルホネートアニオンは、RSOs なる構造式で安わされる。。 ここで R は、フッ素原子、塩素原子、脂肪族 炭化水素 残萎、 芳香族 炭化水素 残萎など これらの 世換体である。 前記脂肪族 炭化水素 残萎の 炭素 数は 1~3であり、 芳香族 炭化水素 残萎は 単環も しくは 二環で、 炭素 数が 6~18 のものがそれぞれ好ましい。 置換体は、アルキル置換体、ハロゲン置換体等が好ましい。

スルホネートアニオンの代表的な例は次の通りである。すなわち、Rがファ素原子の場合のフルオロボかり、Rが脂肪族炭化水果残益の場合はメタンスルホネートアニオン、Rが置換体の場合には、トリフルオロメタンスルホネートアニオンなどがある。

これらのスルホネートアニオンを反応系に存在

本発明の製造方法について説明すると、原料の一つであるツピニルペンセンとしては、p-ツピニルペンセンのいずれを用いても良く、工業的には特にこれらの異性体の混合物が有利に使用できる。また、他方の原料である前記一般式(VI)で表わされるスチレン類にはメが低級アルキル基であるものとして、o,m,p-メテルスチレン、o,m,p-エチルスチレンががカーインプロピルスチレンなど、メがハロケンはアルキル基であるものとして、o,m,p-クロロメチルスチレン、m,p-プロモメチルスチレンなど、またメがアンル本のとして、m,p-アセチルスチレンなど、またメがアンル基であるものとして、m,p-アセチルスチレンなどがあげられる。

さらに、Xがアシルオキシル基であるものとしてm,p-アセトキシスチレンなど、Xがハロゲン原子であるものとして、 o,m,p-クロロスチレン、p-プロモスチレン、p-よう化スチレン、そしてXがヒドロキシル基であるものとしてo,m,p-ヒドロキシスチレンなどがある。

させて反応を進行させるには、酸 (RSO_3H) の形の化合物、あるいはこれらの誘導体である炭素数 $1\sim3$ のアルキル基(R)を有するエステル (RSO_3R') もしくは $(RSO_2)_2$ 0 で表わされる酸 無

水物の形の化合物を反応系に添加する。

スルホネートアニオン(RSOg)を生成させる酸の代表的を例は、フルオロはのないないではない。 ひゃってん オロコー ステルホン酸等 され、エステルはエステルであって、メチルルエステルをよびエチルエステル 等が代表的なって 破かない である。 もちろん酸のではないののかに限定されるものではない。

本発明の製造方法においては、また、過塩素酸アニオン(C104)の存在下でも行なうことができる。この場合、過塩素酸アニオンを生ずるいかなる化合物をも使用することができるが、代数的な

特開昭58-76411(6)

ものは次のような化合物である。すなわち、過塩 素酸(HC104)、過塩素酸アセチル(CH3 COC104)、 過塩素酸プチリル(C3 H7 COC104)、ペンソイルパ ークロレイト(C6 H5 COC104) 等; 過塩素酸のオ キソニウム塩、たとえば、ジオキソレニウムパー クロレイト; 過塩素酸のトリフェニルメチル塩、 すなわち、トリフェニルメチルパークロレイト (Ph3 C + C104); および過塩素酸のトロピリウム 塩のトロピリウムパークロレイト(C7 H7+C104-)等 である。

使用する触媒量(スルホネートアニオンもしくは過塩素酸アニオンの使用量)は、ジピニルベンセン1 モルに対し、 0.05 ~ 100 ミリモルの範囲が好ましい。 この範囲外の量でも使用できるが、少量では反応に長時間を要し、また必要以上に多量の触媒を使用した場合には、触媒除去に手間を要するので経済的に不利である。

反応温度は、 - 20°Cから + 150°C の温度範囲内で任意に選択することができ、反応温度がこの温度範囲から外れた場合には、後述するように倒鎖

更に本発明の製造方法においては、モノマーであるソビニルベンセンの反応系中における濃度が低い方が、式(VII)のようなポリマーを生じないので、たとえば、溶鉄中のソビニルベンセン濃度を20 容量を以下にして使用することが好ましい。

本発明のポリツビニルベンゼン共富合体は前記一般式(VI)で扱わされるスチレン類を共存させて、ジビニルベンゼンをスルホネートアニオンまたは過度を行なうが、ポリツビニルベンセンのホモ重合体としては、下記の一般式(VII)で表わされる重合体があり、この末端に前記スチレン類が付加したものとして本発明の共宜合体が得られる。

- 段式(VII)

上式中でおよび目の定義は前記と同様である。

更に、一般式(VII)のポリツビニルベンセンの片方の 末端にステレン類が付加したものとして前記一般 式(1)および(II)のポリンビニルベンセン共重合 にピニル基を有するポリマー(VII)が生じ、 これは 更に橋かけ反応を惹起し、ポリマーは蔣剤に不溶 性となるので好ましくない。上記より更に好まし い反応温度は+30°Cから+80°Cである。

なか、密媒の極性に関しては飽和脂肪族炭化水 素のように極性の低いものが良く、極性の高い容 媒を用いた場合には側鎖にピニル基を有するポリ マー(VI)を生成し、橋かけ反応が起りやすい。

体、また、両端にスチレン類が付加したものとして一般式(Ⅲ)~(V)のポリンピニルベンセン共重 合体が得られる。

本発明においては、スチレン類を共存させるととにより共産合体を製造初から添加しても良い。
すなわち、ジピニルベンセンとスチレン類とを混合して共産合させても良い。また、重合の定でスチレン類を添加しても良い。更に、ある程度ジピニルベンセンの重合度が上昇してから、すなわち、重合反応の終期に添加しても良い。

なお、グピニルベンセンとスチレン類とを混合して反応させる際に、共重合体の収率を上げるためには、グピニルベンセンに対するスチレン類の割合を小さくすることが好ましい。すなわち、スチレン類とグピニルベンセンの重合の相対速度にもよるが、通常はスチレン類とグピニルベンセンとのモル比は5~0.01の範囲にすることが好ましい。

また、前記一般式(I)~(V)で表わされる本発

明の共重合体の内部二重結合は主としてトランス結合である。

従来の塩化アルミニウムなどのカチオン 重合触 媒を用いてツピニルベンセンを重合すると、前記 一般式(VII)のように側鎖にピニル基を有するポリ マーを生することになる。ポリマー(VII)は側鎖に ピニル基を持つために橋かけ反応を起しやすく、 ・溶剤に不溶性になるので好ましくない。

本発明の製造方法は、スルホネートアニオンまたは選塩素酸アニオンの存在下にジピニルペンゼンを重合させるのであるが、前述のように重合温度が-20°Cから+150°Cの温度範囲を外れるとき、モノマー濃度が高いとき、また極性溶鉄を用いるときには、前配一般式(VII)の構造を有するポリマーが生成し、とのポリマーは更に橋かけ反応を起すので好ましくない。

なお、ヒドロキシル基を末端の官能基として有 するポリシピニルベンゼンを得る場合には、アシ ルオキンスチレンたとえばアセトキシスチレンが 末端に付加したポリピニルベンゼン共重合体を製

次に実施例により本発明を詳述する。 実 施 例 1

乾燥窒素中でp-ジビニルベンゼンとp-メチルスチレンのベンゼン溶液に、過塩素酸アセチル(CH3COC1O4)のベンゼン溶液を加え、p-ジビニルベンゼン濃度 0.05モル/L、p-メチルスチレン濃度 0.05モル/L、触媒濃度 0.2ミリモル/Lの初期条件で 70°C で反応させた。反応時間 5 分、40分かよび 120分でそれぞれサンプルを採取した。その後、アンモニア性メタノールで反応を停止し、波圧下に 50°C で溶媒がよび未反応メタノールを除去した。得られた共重合体の数平均分子量は反応時間 120 分のとき約 800 であった。

次に上記サンプルを GPC にかけその分子最分布を測定した。その結果を第1 図に示す。図中、p - DVB は p - ソピニルベンセン、 p - MeSt は p - メチルスチレンを示し、各曲線のピークに付した数値は重合度を示す。また、5 分、40 分のサンプルについての NMR スペクトルを第2 図に示す。

第1図より、反応時間の経過と共に分子量が増

造し、これを加水分解しても得ることができる。 との加水分解は通常、温度 10° C $\sim 50^{\circ}$ C 、 $1 \sim 4$ 時間の条件で容易に行なうことができる。

本発明のポリッピニルベンゼン共重合体は、少なくともその一端に官能基を有するので、それを 反応させることによって、種々の反応中間体とし て利用することができる。

加するととが解る。また第2図より、モノマー転 化率の高い 40 分のサンプルではメチル基の水条 の吸収(b=2.2 ppm) が大きく、そして、末端ピ ニル基の水米の吸収は殆ど認められず末端が p-メチルスチレンのみになったことが解る。

また、ポリマーの末端の構造を確認するために、分取 GPC により二量体から五量体を分取し、それぞれの NMR スペクトルから末端基の構成割合を求めた。その結果を次の表 1 に示す。なお pーソビニルペンゼン 濃度 0.075モル/ L、pーメチルスチレン 濃度 0.025モル/ L (p - DVB/p - MeSt = $\frac{3}{1}$) の反応系についても重合反応を行ないその結果も併せて示す。

表1 意合体末端差の構成比率

転火	p-DVB		1	f	庚	
化塞	p-MeSt	2	3	4	5	全体
約	1/1	1.06	0.88	0.90	0.97	0.95
50 ≸	3/1	3.07	2.47	2.55	2.92	2.76
約	1/1	0.08	0. 10	0.08	0.07	0.10
100 ≴	3/1	0. 12	0.22	0. 23	0. 24	0.24

夹 施 例 2

p-ジピニルベンゼン 0.025モル/ L と p-T セトキンステレン 0.075モル/ L のベンゼン溶液を実施例1と同様にして反応させた。反応時間 120 分では転化率 100 まであった。このポリマーの NMR スペクトルを第3 図に示す。また、分取 GPC により二量体から五量体を分取し、その末端蓋を調べたところ、末端基はすべてアセトキシル基であって、ビニル基は認められなかった。また、得られた共

独重合させたのち、p-アセトキンスチレンを旅加して共重合させた。

すなわち、乾燥窒素中でp-ジビニルペンセンの 0.05モル/ Lのペンセン溶液に、過塩素酸 アセチルの 0.20ミリモル/ Lのペンセン溶液を加え、70°C で 20 分間反応させた。次にp-アセトキシスチレン(AcOSt)を 0.05モル/ L 加えて反応させた。 との反応の時間 - 転化 年の関係は第 6 図のようであった。 また、p-アセトキシスチレンを 添加する前のポリ ジビニルペンセン(A)と反応終了 後の共重合体(B)とについて GPC により分子量分布を 別定した結果をそれぞれ第7 図 および第8 図に示す。 次にポリジビニルペンセン(A)、共重合体(B)にて NMR スペクトルを第9 図および第10 図にそれぞれ示す。 なお、ポリジビニルペンセンの 数平均分子量は約2000 であった。

NMBスペクトルの結果から、共重合体(B)では末端ピニル基が殆ど消失し、末端アセトキシル基が認められた。また、これらの結果より、末端にアセトキシスチレンが導入されたことが確認された。

重合体の数平均分子量は約500であった。

次にこの共取合体を1.4-ジオキサンの溶媒中で、4時間かけて加水分解したところ、末端がヒドロキンル基であるポリマーが得られた。このポリマーの NMR スペクトルを第4 図に示す。第3図の NMR スペクトルと比較すると末端メチル基の吸収が消失し、代りにヒドロキンル基の水素の吸収が扱われているととが解る。

寒 施 例 3

p-ジビニルペンゼン 0.05モル/ 4、p-クロロメチルスチレン 0.05モル/ 4のベンベン 溶液を実施例 1 と同様にして反応させた。 反応時間 120 分では 転化率 100 多であった。 このポリマーの NMRスペクトルを第 5 図に示す。 また分取 GPC により分取 した二量体から五量体について NMRスペクトルにより末端基を測定したところ、 ビニル基は認められずすべてクロロメチル基であった。 なお、 得られた共産合体の数平均分子量は約 1000 であった。 実施 例 4

本実施例では、p-シピニルペンセンを一度単

夹 施 例 5

実施例1と同様の反応条件において、p-ジピニルペンゼン 0.05モル/L、p-クロロステレン 0.05モル/Lのペンゼン落被を用いて反応させた。 反応時間 120 分で転化率 100 がであった (数平力 か分子量約 1000)。とのポリマーの NMR スペクトルは、メチル基の水果が存在しないとと以外はほぼ 2 図のものと同じであった。また分取 GPC により分取した二量体から五量体について元素分析を行なった結果、オリゴマー1分子に 2 個の原子の終入されたオリゴマーが合成されたことが認められた。

寒 始 例 6

p-ジビニルベンセン 0.025モル/2、p-アセトキシスチレン 0.075モル/2のモノマー機度 およびトリフルオロメタンスルホン酸(CF₃SO₃H)0.10ミリモル/2の初期条件で、70°C で 120 分間ベンセン中で反応させた。得られたポリマーの数平均分子量は 500 であり、その NMRスペクトルは実施

例2に示したものと殆ど同様のものであった。またポリマー全体および分取 GPC で分取した二食体

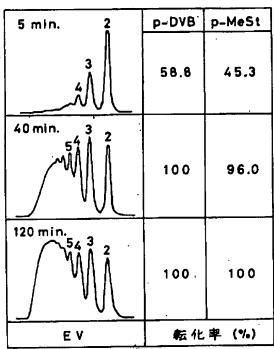
から五量体について NMRスペクトルから剛定した 末端基も実施例 2 のそれとほぼ同様に全てアセト キシル基であった。

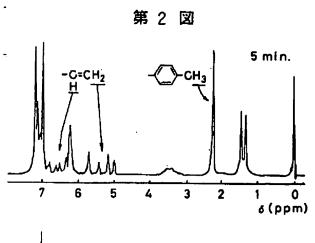
4. 図面の簡単を説明

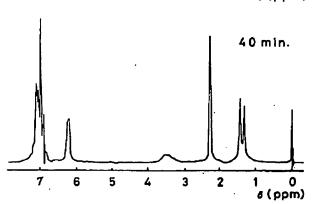
第1図、第7図および第8図は GPC のチャート であり:第2図、第3図、第4図、第5図、第9 図および第10図は NMRのスペクトルであり、また第 6 図は転化率(5)と時間(分)の関係を示すグラフで ある。

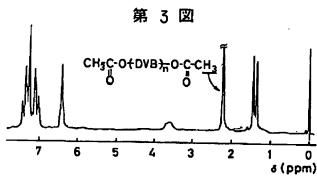
> 特許出願人 東村 **袋**工 正 代理人 弁理士 前 島 華

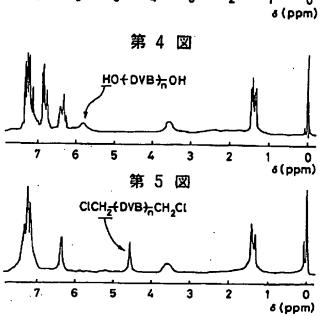
第 1 図



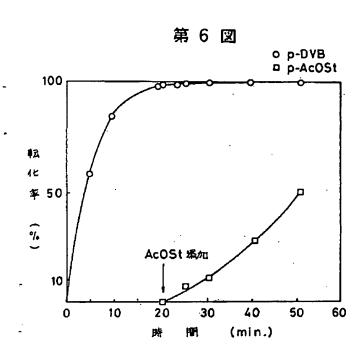


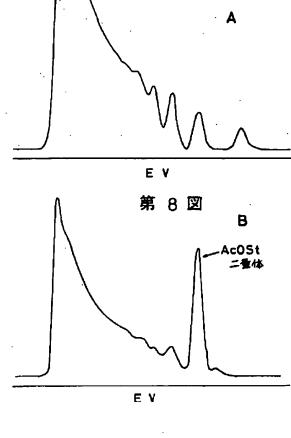


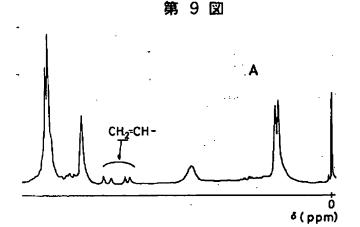




第7図









昭和 56 年 12 月 19日

特許庁長官島 田 春

-1. 事件の表示

昭和 56年 特 許 順 第 174989 号

2 発明の名称 ポリジピニルペンセン共産合体 およびその製法

3. 補正をする者

事件との関係

氏 名(名称)

4. 代 理 人 〒 110 電話 03(841)5861番 東京都台東区上野 7丁目 11番7号 川村ピル (8303) 弁理士 前 島

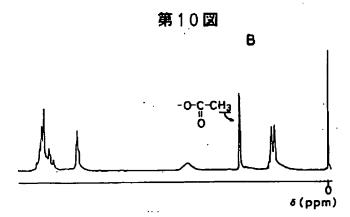
- 5. 補正命令の日付 (自発)
- 6. 補正により増加する発明の数 なし
- 7. 補正の対象

明細書の特許請求の範囲の欄および 発明の詳細な説明の欄

8. 補正の内容

別紙の通り





補正の内容

明細書を以下の通り補正する。

- 1. 特許額求の範囲の機を別紙の通り補正する。
- 2. 発明の詳細な説明の欄を以下の通り補正する。
- (1) 第14 頁、一般式(N)の次の行の「前記定辞と 同じである。」の次に「但し、ヒドロキシル 基を除く。」を加入する。
- (ロ) 第16 頁、下から 3 行目から最下行の「、そして X が・・・・・ヒドロキシスチレン」を削除する。
- (ハ) 第23 頁、最下行の「ポリピニルベンセン」を 「ポリクピニルベンセン」と訂正する。
- (=) 第24 頁、第1行の「加水分解しても」を「加水分解することによって」と訂正する。

2. 特許請求の範囲

(1) 下記一般式(I)から(V)で表わされる群から選ばれた 1 種または 2 種以上の化合物からなるポリジピニルペンセン共重合体、

一般式(1)

一 般 式(1)

$$X \xrightarrow{\text{CH-CH=CH-}} CH \xrightarrow{\text{CH-CH}_2} CH = CH_2$$

一般式(Ⅱ)

· 一般式(IV)

- 股式(V)

但し、上記一般式(I)から(V)において、 X は低級アルキル基、ハロゲン化アルキル基、アンル基。アンルオキシル基、ヒドロキシル基もしくはハロゲン原子を表わし、 r は O 以上の整数であり、かつ r 個の M は、それぞれ下記繰返し単位(A)または(B)である。

繰返し単位(A)

繰返し単位(B)

- (2) 前記ポリグピニルペンセン共重合体中の二重結合が主としてトランス結合である特許請求の範囲 第1項記載のポリグピニルペンセン共重合体。
- (3) 前記ポリジビニルペンゼン共重合体中のジビニ

ルベンゼン単位が p- 置換 ツピニルベンゼン単位 および/または m- 置換 ツピニルベンゼン単位で ある特許請求の範囲第 1 項または第 2 項記載のポ リ ツピニルベンゼン共重合体。

- (4) 前記 X がメチル基である特許請求の範囲第1項ないし第3項のいずれかに記載のポリンピニルペンセン共重合体。
- (5) 前記 X がクロロメチル基である特許請求の範囲 第1 項ない し第3 項のいずれかに記載のポリシピ ニルベンゼン共重合体。
- (6) 前記 X が T セトキシル基である特許請求の範囲 第1 項をいし第3 項のいずれかに記載のポリシピ ニルベンセン共粛合体。
- (7) 前記 X が塩素原子である特許請求の範囲第1項 ないし第3項のいずれかに記載のポリジビニルペ ンセン共重合体。
- (8) 前記 X が ア セチル基である特許請求の範囲第 1 項ない し第 3 項のいずれかに記載のポリシピニル ベンセン共重合体。
- (9)スルホネートアニオンまたは過塩素酸アニオン

の存在下に、-20°C~+150°Cにおいて、シピニルペンセンを重合するに際し、下配一般式(VI)で示されるステレン類を共存させるととを特徴とする、下記一般式(I)から(V)で表わされる群から選ばれた1種または2種以上の化合物からなるポリジピニルペンセン共業合体の製法。

一 股 式([)

$$X \xrightarrow{\text{CH-CH-CH}} CH_3 \xrightarrow{\text{CH-CH}_2} CH = CH_2$$

─ 般 式(I)

一般式(Ⅱ)

繰返し単位(B)

- (10)前記ポリジピニルベンセン共重合体の二重結合が主としてトランス結合である特許請求の範囲第9項記載のポリジピェルベンセン共重合体の製法。
- (11)前記シピニルペンゼンが p-シピニルペンゼン および/またはm-シピニルペンゼンである特許 請求の範囲第9項または第10項記載のポリシピニ ルペンゼン共賞合体の製法。
- (12) 前記一般式(VI)で示されるスチレン類がメチルスチレンである特許請求の範囲第 8 項ないし第 11 項のいずれかに記載のポリジピニルベンゼン共創合体の製法。
- (13) 前配一般式(VI)で示されるステレン類がクロロ メテルスチレンである特許請求の範囲第9項ない し第11項のいずれかに記載のポリジピニルペンゼ ン共重合体の製法。
- (14) 前記一般式(VI)で示されるステレン類がアセト キンステレンである特許請求の範囲第9項ないし

- 股 式(N)

$$X \xrightarrow{CH-CH-CH-CH} \xrightarrow{CH-CH-CH-CH} X$$

一 較 式(V)

- 股式(V)

但し、上記一般式(I)から(VI)において、 X は低級アルヤル基、ハロゲン化アルキル基、アシル基、アシル基、アシル基もしくはハロゲン原子を要わし、 rは O 以上の整数であり、か・ 個の M は、それ ぞれ下記練返し単位(A)または(B)である。

練返し単位(A)

第11·項のいずれかに記載のポリジピニルペンセン 共食合体の製法。

- (15) 前記一般式(VI)で示されるスチレン類がクロロスチレンである特許請求の範囲第9項をいし第11項のいずれかに記載のポリクピニルベンゼン共重合体の製法。
- (16) 前記一般式(VI)で示されるスチレン類がアセチルスチレンである特許請求の範囲第 9 項ない し第 11項のいずれかに記載のポリグピニルベンセン共 重合体の製法。
- (17) スルホネートアニオンまたは過塩素酸アニオンの存在下に、-20°C~+150°Cにおいて、シピニルペンセンを重合するに際し、下配一般式(V')で示されるアシルオキシスチレンを共存させて得られたポリジピニルペンセン共重合体を加水分解するととを特徴とする下記一般式(J')から(V)で表わされる群から選ばれた1種または2種以上の化合物からなるポリジピニルペンセン共重合体の製法、

$$\begin{array}{c} \text{HO} & \xrightarrow{\text{CH=CH-CH}_2} & \xrightarrow{\text{CH=CH}_2} & \\ \text{CH}_3 & \xrightarrow{\text{CH=CH}_2} & \\ \end{array}$$

一般式(I')

一 般 式(11)

- 般 式(N')

一 股 式(Ⅴ)

ルペンセン共重合体の製法。

(20) 前記アシルオキシスチレンがアセトキシスチレンである特許請求の範囲第17項ないし第19項のいずれかに記載のポリンピニルベンセン共重合体の製法。

一 股 式(YI')

但し、上記一般式(『)から(VI') において、X':はア シルオヤシル基を表わし、 r は 0 以上の整数であ り、かつ r 個の N は、それぞれ下記録返し単位(A) または(B)である。

繰返し単位(A)

繰返し単位(B)

- (18) 前記ポリジピニルベンゼン共頂合体中の二重結合が主としてトランス結合である特許請求の範囲第17項記載のポリジピニルベンゼン共重合体の製法。
- (19) 前記シピニルペンセンが p-シピニルペンセン および/または m-シピニルペンセンである特許 請求の範囲第17項または第18項記載のポリシピエ